## 03,09,12

# Спектры отражения и фотоотражения структур с квантовыми ямами на основе ZnO

© А.М. Клюев<sup>1</sup>, Н.Г. Философов<sup>2</sup>, А.Ю. Серов<sup>2</sup>, В.Ф. Агекян<sup>2</sup>, С. Morhain<sup>3</sup>, В.П. Кочерешко<sup>1,¶</sup>

 <sup>1</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
<sup>2</sup> Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург, Россия
<sup>3</sup> Centre de Recherche sur l'Hétéro-Epitaxie et ses Applications CRHEA-CNRS
<sup>¶</sup> E-mail: Vladimir.Kochereshko@mail.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 13 июня 2020 г. В окончательной редакции 13 июня 2020 г. Принята к публикации 16 июня 2020 г.

Исследованы спектры отражения и модуляционного фотоотражения от эпитаксиальных слоев ZnO и  $Zn_{1-x}Mg_xO$ , а также квантовых ям ZnO/Zn<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>O при нормальном и наклонном падении света. Сравнение экспериментально измеренных и расчетных спектров позволило уточнить некоторые параметры экситонов в этих структурах и уточнить порядок следования энергетических зон в ZnO.

Ключевые слова: гетероструктуры, квантовые ямы, экситоны, спектроскопия.

DOI: 10.21883/FTT.2020.11.50052.127

# 1. Введение

Широкозонные полупроводниковые соединения, такие как ZnO, GaN, MgO, AlN представляются чрезвычайно перспективными материалами для оптоэлектроники. Благодаря большой ширине запрещенной зоны такие структуры удобны для изготовления полупроводниковых лазеров, работающих в ультрафиолетовом диапазоне и сверхвысоковольтных транзисторов. Очень часто в таких структурах благодаря пьезоэффекту появляется встроенное электрическое поле напряженностью до нескольких миллионов вольт на сантиметр [1]. В то же время в этих материалах наблюдается и достаточно большая концентрация примесей, достигающая 10<sup>18</sup> сm<sup>-3</sup>, что приводит к частичной экранировке этого встроенного поля. В результате величина встроенного поля меняется в зависимости от вида структуры и даже от условий, при которых они исследуются. Как следствие, многие свойства экситонных и трионных состояний, зависят от встроенного электрического поля и оказываются плохо контролируемыми. Дело доходит до того, что даже интерпретация экситонных и трионных линий в спектрах таких структур оказывается неоднозначной. Имеются значительные расхождения и в опубликованных величинах параметров экситона [2]. Более того, с шестидесятых годов [3,4] и до сих пор ведется дискуссия о порядке следования энергетических зон в оксиде цинка и гетероструктурах на основе ZnO [5]. Это обосновывает актуальность исследований этих материалов.

В работе экспериментально и теоретически исследовались спектры отражения и фотоотражения при нормальном и наклонном падении света от гетероструктур, содержащих как слои ZnO и  $Zn_{1-x}Mg_xO$ , так и квантовые ямы ZnO/Zn<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>O с содержанием Mg x = 0.22.

# 2. Эксперимент и результаты

На подложке сапфира был выращен буферный слой ZnO толщиной порядка 1 mkm, затем выращивался барьерный слой Zn<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>O толщиной 200 nm, следом за ним выращивались квантовая яма ZnO толщиной 7.1 nm, еще один барьерный слой Zn<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>O толщиной 200 nm, квантовая яма ZnO толщиной 2.7 nm и покрывающий слой Zn<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>O толщиной 200 nm.

Спектры отражения регистрировались с помощью галогенной лампы и монохроматора МДР-406, оснащенного фотоумножителем, в режиме счета фотонов, температура образца во всех экспериментах составляла 5 К. Спектры фотоотражения регистрировались при дополнительной подсветке образца импульсами лазера с длиной волны 332 nm с последующим синхронным детектированием сигнала.

На рис. 1, а представлен спектр отражения (сплошная кривая), снятый при нормальном падении света на образец при температуре 5 К. В спектре отчетливо наблюдаются экситонные линии: в слое ZnO, на энергии 3.370 eV, в слое  $\text{Zn}_{1-x}\text{Mg}_x\text{O}$ , на энергии 3.65 eV, и квантовой яме (КЯ) шириной 2.7 nm на энергии 3.444 eV. Эти линии были идентифицированы в работе [6] путем сравнения спектров отражения и фотолюминесценции. Однако, идентификация экситонных линий от КЯ, шириной 7.1 nm вызвала затруднения. Так в работе [7] считали, что линия экситона в широкой КЯ сильно сдвинута пьезоэлектрическим полем в длинноволновую часть спектра в область 3.2 eV, а в работе [8] предполагалось, что сигнал фотолюминесценции в этой области спектра связан с рекомбинацией донорно-акцепторных пар.



**Рис. 1.** *а*) Экспериментально измеренный спектр отражения (сплошная кривая) при нормальном падении света, T = 5 К. Стрелками показаны энергии экситонных резонансов в слое оксида цинка (ZnO) и квантовой яме шириной 7.1 nm (QW). Расчет спектра отражения (пунктирная кривая) с параметрами, приведенными в таблице. *b*) Экспериментально измеренный спектр отражения (сплошная кривая) при нормальном падении света, T = 5 К. Расчет спектра отражения (пунктирная кривая) без учета квантовой ямы.

Помимо этих экситонных линий в длинноволновой части спектра отражения наблюдается интерференционная картина, связанная с квантованием поляритонов в слое ZnO. Еще одно обстоятельство обращает на себя внимание: наблюдаемая в коротковолновой части спектра линия экситонного отражения имеет "перевернутую" форму. Подобное вращение контура экситонного отражения происходит при интерференции света в толстом безэкситонном слое [9,10] вблизи поверхности.

На этом же рисунке представлен расчет спектра отражения от исследуемой структуры с учетом вклада обеих КЯ. Видно, достаточно хорошее совпадение расчетного спектра с экспериментально измеренным. Для того чтобы выявить вклад КЯ шириной 7.1 nm в спектр отражения, мы провели расчет этого спектра с учетом и без учета этой КЯ, при этом все остальные параметры расчета не менялись. Видно, что в области энергий 3.36 eV не удается добиться удовлетворительного совпадения расчетного спектра с измеренным без учета вклада от этой КЯ (рис. 1, b).

Таким образом, вопреки утверждению многих статей, длинноволновый сдвиг экситонных линий в КЯ в пьезоэлектрическом поле данной структуры не так уж велик и составляет всего несколько meV. Малая величина штарковского сдвига экситонных линий, вероятно, обусловлена экранированием пьезоэлектрического поля свободными носителями, пришедшими с доноров, а также рожденными светом в процессе эксперимента.

Для дополнительной проверки этого факта были измерены спектры модулированного фотоотражения dR/R(рис. 2). В этом эксперименте для надбарьерной подсветки использовался лазер с энергией кванта 3.815 eV и строилась разность сигналов с подсветкой и без нее

$$rac{dR}{R} = rac{R(\omega_0+\delta)-R(\omega_0-\delta)}{R(\omega_0+\delta)+R(\omega_0-\delta)}.$$

Здесь: R — коэффициент отражения,  $\omega_0$  — частота экситонного резонанса,  $\delta$  — вариация резонансной частоты. В расчете мы считали, что  $\delta = 1$  meV.

На рис. 2 видны яркие особенности в области энергий 3.376 eV и интерференционная картина в области 3.340 eV. На этом же рисунке представлен расчетный спектр фотоотражения в предположении, что главный вклад в спектр происходит от изменения резонансной частоты экситона в толстом слое ZnO и в KЯ шириной 7.1 nm. Расчет показал, что при изменении других экситонных параметров, таких как сила осциллятора и/или



Рис. 2. Спектральная зависимость сигнала дифференциального фотоотражения при дополнительной надбарьерной подсветке. Сплошная кривя — эксперимент, пунктирная кривая расчет.



**Рис. 3.** Спектр отражения, зарегистрированный при наклонном падении света, T = 5 К. Стрелками указаны экситонные резонансы, поляризованные перпендикулярно гексагональной оси  $(P_x, P_y)$  и вдоль гексагональной оси  $(P_z)$ .

затухание не удается получить достаточно хорошее совпадение расчета с экспериментом.

Для дальнейшего уточнения параметров были измерены спектры отражения при наклонном падении света под углом ~ 30 градусов. Неожиданно оказалось, что при наклонном падении в спектре появляется еще одна линия отражения с энергией 3.424 eV (рис. 3). При этом общий вид спектра соответствует случаю нормального падения. Очевидно, что эта новая линия связана с экситонным переходом, поляризованным вдоль гексагональной оси. Это указывает на то, что в данной структуре реализуется нормальный порядок зон ( $E_g^A < E_g^B < E_g^C$ ), предложенный в работе [3]. Возможно, что различие в расположении зон, представленное в разных публикациях, связано с различием механических напряжений в структурах, выращенных в разных условиях (на подложке и без подложки).

## 3. Теория

В расчете рассматривалась структура, состоящая из следующих слоев: подложка из сапфира, слой ZnO толщиной порядка 1 mkm, затем слой  $Zn_{1-x}Mg_xO$  толщиной 200 nm, за ним КЯ толщиной 7.1 nm, еще один барьерный слой толщиной 200 nm, КЯ толщиной 2.7 nm и покрывающий слой толщиной 200 nm.

Считалось, что показатель преломления света в сапфире равен  $n_{Sa} = 1.7$ , фоновые диэлектрические проницаемости в ZnO и Zn<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>O одинаковы и равны  $\varepsilon_0 = 4.2$  [11].

Распространение света в слоях рассчитывалось методом матриц переноса. Мы считали, что в барьерных слоях  $Zn_{1-x}Mg_xO$  экситонное затухание велико

Параметры экситонов ( $\hbar\omega_0$  — резонансная частота экситона,  $\hbar\omega_{LT}$  — продольно поперечное расщепление,  $\hbar\Gamma$  — затухание,  $\varepsilon_0$  — фоновая диэлектрическая проницаемость)

| Параметр               | $\hbar\omega_0$ , eV | $\hbar\omega_{LT}^*$ , eV | ħΓ, meV   | $\mathcal{E}_0$ |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| ZnO<br>$Zn_{1-x}Mg_xO$ | 3.373<br>3.650       | 6.2<br>9.5                | 1.9<br>15 | 3.82<br>3.75    |
| QW<br>7.1 nm           | 3.370                | 14.0                      | 2.1       | 3.82            |

Примечание. Для квантовой ямы приведена величина эффективного продольно-поперечного расщепления, полученная при переходе от нелокального отклика к локальному [12].

и пространственную дисперсию в них учитывать не нужно. Это предположение подтверждается большим неоднородным уширением экситонной линии отражения в барьерах. Отражение света от КЯ рассматривалось в модели нелокального отклика [12]. Пространственная дисперсия учитывалась только для слоя ZnO. В таблице представлены параметры экситонов, которые использовались в расчете.

При теоретическом описании "перевернутого" контура отражения (рис. 4) в барьерном слое мы считали, что происхождение безэкситонного слоя связано с наличием вблизи поверхности электрического поля, вызванного ионизованными примесями в приповерхностной области кристалла. В этом поле затухание экситона сильно возрастает, что и приводит к перевороту контура экситонного отражения.

Предположим, что концентрация ионизованных примесей вблизи поверхности равна  $(N_D - N_A)$ , плотность заряда этих примесей  $\rho = e(N_D - N_A)$ . Тогда напряжен-



**Рис. 4.** Измеренный спектр отражения в области экситона барьерного слоя  $Zn_{1-x}Mg_xO$  (сплошная кривая) и рассчитанные спектры отражения без учета приповерхностного электрического поля (пунктирная кривая) и с учетом приверхностного поля (штрих-пунктирная кривая).

ность поля, создаваемого этими примесями, будет

$$E(z) = \frac{4\pi e}{\varepsilon_0} (N_D - N_A)(z - z_0), \quad E(0) = E_s.$$

Здесь: *z*<sub>0</sub> — длина экранирования поверхностных состояний свободными носителями, *E<sub>s</sub>* — величина поля на поверхности.

То есть мы считали, что в приповерхностной области поле меняется линейно, и экситонное затухание также линейно зависит от поля.

Для расчета экситонного отражения с учетом приверхностного поля использовалась многослойная аппроксимация безэкситонного слоя. Приповерхностная область разбивалась на слои толщиной 1 nm и в каждом слое задавались параметры экситона. Мы считали, что сила осциллятора и резонансная частота не меняются от слоя к слою, а затухание линейно растет при приближении к поверхности. Такая зависимость подтверждается расчетами влияния электрического поля на атом водорода и экситон [10,13]. Сравнение экспериментально измеренного и расчетного контура отражения экситона в слое  $Zn_{1-x}Mg_xO$  представлено на рис. 4 с учетом и без учета приповерхностного электрического поля.

# 4. Обсуждение и выводы

В настоящей работе в расчете спектров экситонного отражения мы не учитывали пространственную дисперсию в слоях  $Zn_{1-x}Mg_xO$ . Это связано с тем, что, во-первых, в этих слоях мы не наблюдаем размерного квантования поляритонов, во-вторых, линия отражения экситона имеет большое неоднородное уширение, что указывает на сильные флуктуации ширины запрещенной зоны в твердом растворе  $Zn_{1-x}Mg_xO$ . Следовательно, затухание экситона в этих слоях велико и превосходит величину продольно-поперечного расщепления. В этом случае пространственную дисперсию учитывать не нужно [12]. Действительно, рассогласование решеток ZnO и MgO достигает ~ 10%, и такой твердый раствор должен быть сильно неоднородным.

Качество слоев ZnO гораздо выше, на это указывает интерференционная структура с узкими линиями. В этом случае учет пространственной дисперсии необходим. Экситоны в квантовых ямах мы рассматривали в модели нелокального отклика.

Из сравнения экспериментально измеренного и расчетного спектров было установлено, что экситонный резонанс в КЯ 7.1 nm находится на энергии 3.37 eV. Это указывает на эффективное экранирование пьезоэлектрического поля свободными носителями. Действительно, концентрация примесей в нашей структуре составляет  $(N_D - N_A) \approx 3 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ , такой концентрации достаточно для экранирования встроенного поля уже на расстояниях  $\sim 30 \text{ nm}$  [6]. Были установлены величины сил осциллятора (продольно- поперечного расщепления) и затухания экситона в слоях ZnO, Zn<sub>1-x</sub>Mg<sub>x</sub>O и в KЯ.

Спектр отражения, снятый при наклонном падении, указывает на то, что в нашей структуре реализуется нормальный порядок валентных зон в слое ZnO.

#### Финансирование работы

ФНГ, АЮС и ВФА благодарят проект СПбГУ INI\_2019, ID: 37688845 за частичную поддержку работы.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

#### Список литературы

- Tomoki Abe, Tatsuya Motoyama, Masaya Yamamoto, Atsushi Yamamoto, Shohei Iwagashita, Hirofumi Kasada, Koshi Ando, and Kunio Ichino. Phys. Status Solidi C 13, 7–9, 602 (2016).
- [2] Ü. Özgür, Ya.I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M.A. Reshchikov, S. Doğan, V. Avrutin, S.-J. Cho, H. Morkoç. J. Appl. Phys. 98, 041301 (2005).
- [3] D.G. Thomas. J. Phys. Chem. Solids 15, 86 (1960).
- [4] Y.S. Park, C.W. Litton, T.C. Collins, D.C. Reynolds. Phys. Rev. 143, 512 (1966).
- [5] J. Puls, S. Sadofev, F. Henneberger. Phys. Rev. B 85, 041307(R) (2012).
- [6] M.N. Bataev, N.G. Filosofov, A.Yu. Serov, V.F. Agekyan, C. Mohrain, V.P. Kochereshko. Phys. Solid State, 60, 2491 (2018).
- [7] C. Morhain, T. Bretagnon, P. Lefebvre, X. Tang, P. Valvin, T. Guillet, B. Gil, T. Taliercio, M. Teisseire-Doninelli, B. Vinter, C. Deparis. Phys. Rev. B 72, 241305R (2005).
- [8] Thierry Bretagnon. Turkish J. Phys. **38**, 420 (2014).
- [9] Е.Л. Ивченко, П.С. Копьев, В.П. Кочерешко, И.Н. Уральцев, Д.Р. Яковлев, С.В. Иванов, Б.Я. Мельцер, М.А. Калитиевский. ФТП 22, 784 (1988).
- [10] В.А. Киселев, Б.В. Новиков, А.Е. Чередниченко. Экситонная спектроскопия приповерхностной области полупроводников. Изд-во СПб ун-та, СПб (2003).
- [11] Landolt-Bornstein "Numerical Data and Functional Relationship in Science and Technology" / Ed. W. Martienssen. Group III: Condensed Matter, Springer (2000).
- [12] E.L. Ivchenko. Optical Spectroscopy of Semiconductor Nanostructures. Alpha Science Int., Harrow, UK (2005).
- [13] V.V. Kolosov. J. Phys. B 20, 2359 (1987).

Редактор К.В. Емцев